(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

第2670700号

(45)発行日 平成9年(1997)10月29日

(24)登録日 平成9年(1997)7月11日

(51) Int.Cl.⁶ H 0 5 K 3/46 識別記号 庁内整理番号

FI TOEK 3/AG 技術表示箇所

H 0 5 K 3/46

G

N

請求項の数5(全 7 頁)

(21)出願番号	特膜平1-69093	(73)特許權者	9999999	
			日立精工株式会社	
(22)出顧日	平成1年(1989)3月20日		神奈川県海老名市上今泉2100番地	
,, ,		(72)発明者	荒井 邦夫	
(65)公開番号	特開平3-129795		神奈川県海老名市上今泉2100番地	日立
(43)公開日	平成3年(1991)6月3日		精工株式会社内	
		(72)発明者	金谷 保彦	
			神奈川県海老名市上今泉2100番地	日立

精工株式会社内 (74)代理人 弁理士 小林 保 (外1名)

審査官 岡田 和加子

(54) 【発明の名称】 プリント基板、及びプリント基板製造方法

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】絶縁層と該絶縁層の少なくとも一方の面に 形成される銅箔層とからなるプリント基板の一方の面か ら上記一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該プリント基板 の穴明け側にメッキ層を形成して前記盲穴と一方の銅箔 をメッキ導通してなる2以上のプリント基板をそれぞれ 盲穴が内側になるように絶縁層を介して積層し、盲穴に 接する最外層銅箔層にリフローパッドを形成してなるプ リント基板。

【請求項2】絶縁層と該絶縁層の少なくとも一方の面に 形成される銅箔層とからなるプリント基板の一方の面か ら上記一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該プリント基板 の穴明け側にメッキ層を形成して前記盲穴と一方の銅箔 をメッキ導通してなる第1の基板と、絶縁層と該絶縁層 の少なくとも一方の面に形成される銅箔層とからなるプ 2

リント基板の一方の面から上記一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該プリント基板の穴明け側にメッキ層を形成して前記盲穴と一方の銅箔をメッキ導通してなる第2の基板とを前記穴明け側が対向するように絶縁体を介して積層し、さらにスルーホール穴明けをして所定銅箔層をメッキ導通せしめ、盲穴を封止する銅箔層にリフローパッドをエッチングにより形成するプリント基板製造方法。 【請求項3】上記プリント基板の穴明け側に銅箔層が形成されていない場合には、穴明け側にアディティブ法で10パターン形成すると同時に該盲穴と銅箔層をメッキ導通させたものである請求項2記載のプリント基板製造方

【請求項4】上記プリント基板の穴明け側に銅箔層が形成されている場合には、銅箔層の穴明け位置をエッチング等により予め除去して一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔

し、該穴明け側にサブトラクティブ法でパターン形成 し、該盲穴にメッキ層を形成して2つの銅箔層間を導通 さるようにしたものである請求項2記載のプリント基板 製造方法。

【請求項5】上記穴明けは、CO₂レーザで行うものである請求項2、3又は4記載のプリント基板製造方法。

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】

本発明は、プリント基板に係り、特に、高密度化に最 適なブラインドホール接続をすることのできるプリント 基板、及びプリント基板製造方法に関する。

【従来の技術】

多層プリント基板の外部導電層と内部導電層との電気 的接続方法としては、例えば、特公昭58-57000号公 報、特開昭62-54496号公報に示されるようなものがあ る。これらの従来のプリント基板は、第3図に示す如き 構成を有している。すなわち、プリント基板100は、3 層状に形成される絶縁体101、102、103を有している。 この絶縁体101の一方の絶縁体102との接触面には、所定 幅の内層導電層104が、また、絶縁体101の他方の面に は、所定幅の内層導通盲穴用パッド105が形成されてい る。この内層導電層104及び内層導通盲穴用パッド105 は、銅箔層によって構成されており、この内層導電層10 4に至る盲穴106が絶縁体101の他方の面から形成されて いる。この盲穴106内には、メッキ層107が形成されてお り、このメッキ層107によって内層導電層104及び内層導 通盲穴用パッド105が導通されている。この内層導通盲 穴用パッド105に隣接して部品実装用リフローパッド108 が形成されている。また、絶縁体103の一方の絶縁体102 との接触面には、所定幅の内層導電層109が、また、絶 縁体103の他方の面には、所定幅の内層導通盲穴用パッ ド110が形成されている。この内層導電層109及び内層導 通盲穴用パッド110は、銅箔層によって構成されてお り、この内層導電層109に至る盲穴111が絶縁体103の他 方の面から形成されている。この盲穴111内には、メッ キ層112が形成されており、このメッキ層112によって内 層導電層109及び内層導通盲穴用パッド110が導通されて いる。この内層導通盲穴用パッド110に隣接して部品実 装用リフローパッド113が形成されている。また、この プリント基板100の盲穴106、111の近傍には、絶縁体10 1、102、内層導電層109、絶縁体103を貫通する2つのス ルーホール114、115が形成されており、このスルーホー ル114、115内には、メッキ層116、117が形成されてい る。このメッキ層116は、内層導電層104と導通してお り、メッキ層117は、内層導電層109と導通している。

このプリント基板は、第4図に示す如き方法に基づいて製造される。すなわち、まず、第4図(A)に示す如く、内層パターン形成用のエッチング工程において、絶縁体102の両面に形成されている内層導電層104、109をそれぞれ所定パターンにエッチングする。次に、第4図

(B) に示す如く、積層工程において、エッチングされた内層導電層104の上には、絶縁体101の上に銅箔によって構成される外層導電層105を積層して一体に形成された基板を内層導電層104の上に重ねて加熱圧着する。ま

た、エッチングされた内層導電層109の上には、絶縁体1 03の上に銅箔によって構成される外層導電層110を積層 して一体に形成された基板を内層導電層109の上に重ね て加熱圧着する。このようにしてプリント基板を多層基

板化する。そして、第4図(C)に示す如く、エッチン 10 グ工程において、外層導電層105及び外層導電層110のそ れぞれに所定幅の窓118、119をエッチングにより形成す

る。この窓118、119を形成する位置は、第4図(A)に おけるエッチング工程において、エッチングにより残し

た内層導電層104、109に対応する位置である。その後、

第4図(D)に示す如く、レーザ穴明け工程において、 窓118、119から絶縁体101及び絶縁体103にレーザ120を

照射して絶縁体101及び絶縁体103の絶縁層を除去し、内 層導電層104、109に達する盲穴106、111を開ける。次

に、第4図(E)に示す如く、スルーホール穴明け工程) において、基板上の適宜位置に絶縁体101、102、103、

内層導電層104、109、外層導電層105、110を貫通する2

つのスルーホール114、115を形成した後、第4図(F) に示す如く、メッキ工程において、外層導電層105、110

に示す如く、メッキ上程において、外層等電周105、110 の上、盲穴106、111の内側、スルーホール114、115の内

側にメッキを施し、メッキ層116を形成する。このメッキ層116によって外層導電層105と内層導電層104とを、

外層導電層110と内層導電層109とをそれぞれ導通する。

そして、第4図(G)に示す如く、パターンエッチング 工程において、外層導電層105、110をエッチングして、

内層導通盲穴用パッド105、110、部品実装用リフローパッド108を形成する。

【発明が解決しようとする問題点】

しかしながら、従来のプリント基板100にあっては、 多層プリント基板の最外層に部品実装用リフローパッド 108と内層導通用のパッド105、110とを別々に(別な場 所に)設けていたため、実装面積が少なくなり実装密度 が悪いという問題点を有している。

また、従来のプリント基板製造方法にあっては、内層 を構成する絶縁体から逐次積層していく方法であるため、さらに内層数が増えた場合、さらに積層、パターン 加工を繰り返していくため、位置決め用穴が熱伸縮によってダメージを受け長穴に変形してしまい、内層材が互いにズレたり、パターンズレが発生し易くなるという問題点を有している。

本発明は、従来の技術の有するこのような問題点に鑑 みてなされたものであり、ブラインドホールを有するプ リント基板の実装密度を向上することのできるプリント 基板、及びプリント基板製造方法を提供しようとするも のである。

0 【問題点を解決するための手段】

10

20

30

50

5

上記目的を達成するために、本発明のプリント基板に おいては、絶縁層と該絶縁層の少なくとも一方の面に形 成される銅箔層とからなるプリント基板の一方の面から 上記一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該プリント基板の 穴明け側にメッキ層を形成して前記盲穴と一方の銅箔を メッキ導通してなる2以上のプリント基板をそれぞれ盲 穴が内側になるように絶縁層を介して積層し、盲穴に接 する最外層銅箔層にリフローパッドを形成して構成した ものである。

また、上記目的を達成するために、本発明のプリント 基板製造方法においては、絶縁層と該絶縁層の少なくと も一方の面に形成される銅箔層とからなるプリント基板 の一方の面から上記一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該 プリント基板の穴明け側にメッキ層を形成して前記を と一方の銅箔をメッキ導通してなる第1の基板と、絶縁 層と該絶縁層の少なくとも一方の面に形成される銅箔層 とからなるプリント基板の一方の面から上記一方の銅箔をメッキ導通して をからなるプリント基板の一方の面から上記一方の銅箔を とからなるプリント基板の一方の面から上記一方の銅箔を とからなるプリント基板の一方の頭箔をメッキ導通して なる第2の基板とを前記穴明け側が対向するように なる第2の基板とを前記穴明け側が対向するように色縁 体を介して積層し、さらにスルーホール穴明けをして 定銅箔層をメッキ導通せしめ、盲穴を封止する銅箔層に リフローパッドをエッチングにより形成するようにした ものである。

そして、上記プリント基板の穴明け側に銅箔層が形成 されていない場合には、穴明け側にアディティブ法でパ ターン形成すると同時に該盲穴と銅箔層をメッキ導通さ せるようにしたものである。

さらに、上記プリント基板の穴明け側に銅箔層が形成されている場合には、銅箔層の穴明け位置をエッチング等により予め除去して一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔し、該穴明け側にサブトラクティブ法でパターン形成し、該盲穴にメッキ層を形成して2つの銅箔層間を導通させるようにしたものである。

また、上記穴明けは、CO₂レーザで行うのが好ましい。

【作用】

絶縁層と該絶縁層の少なくとも一方の面に形成される 銅箔層とからなるプリント基板の一方の面から上記一方 の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該プリント基板の穴明け側 にメッキ層を形成して前記盲穴と一方の銅箔をメッキ導 通してなる2以上のプリント基板をそれぞれ盲穴が内側 になるように絶縁層を介して積層し、盲穴に接する最外 層銅箔層にリフローパッドを形成して構成しているの で、ブラインドホールを有するプリント基板の実装密度 を向上することができる。

また、絶縁層と該絶縁層の少なくとも一方の面に形成 される銅箔層とからなるプリント基板の一方の面から上 記一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該プリント基板の穴 明け側にメッキ層を形成して前記盲穴と一方の銅箔をメ 6

ッキ導通してなる第1の基板と、絶縁層と該絶縁層の少なくとも一方の面に形成される銅箔層とからなるプリント基板の一方の面から上記一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該プリント基板の穴明け側にメッキ層を形成して前記盲穴と一方の銅箔をメッキ導通してなる第2の基板とを前記穴明け側が対向するように絶縁体を介して積層し、さらにスルーホール穴明けをして所定銅箔層をメッキ導通せしめ、盲穴を封止する銅箔層にリフローパッドをエッチングにより形成して製造されるものであるから、ブラインドホールを有するプリント基板の実装密度を向上することができる。

【実施例】

以下、本発明の実施例について説明する。

第1図には、本発明に係るプリント基板の一実施例が 示されている。

図において、プリント基板1は、3層状に形成される 絶縁体2、3、4を有している。この絶縁体2の一方の 絶縁体3との接触面には、所定幅の内層導電層5が、ま た、絶縁体2の他方の面には、所定幅のリフローパッド 6が形成されている。この内層導電層5及びリフローパッド 6は、銅箔層によって構成されており、この内層導 電層5に至る盲穴7が絶縁体2の一方の絶縁体3側の面 から形成されている。この盲穴7内には、メッキ層8が 形成されており、このメッキ層8によって内層導電層5 及びリフローパッド6が導通されている。このリフロー パッド6は、盲穴7上に形成されている。

また、絶縁体4の一方の絶縁体3との接触面には、所定幅の内層導電層9が、また、絶縁体4の他方の面には、所定幅のリフローパッド10が形成されている。この内層導電層9及びリフローパッド10は、導箔層によって構成されており、この内層導電層9に至る盲穴11が絶縁体4の一方の絶縁体3側の面から形成されている。この盲穴11内には、メッキ層12が形成されており、このメッキ層は12によって内層導電層9及びリフローパッド10が導通されている。このリフローパッド10は、盲穴11上に形成されている。

また、このプリント基板1の盲穴7、11の近傍には、 絶縁体2、3、4を貫通して形成される2つのスルーホ ール13、14が形成されており、このスルーホール13、14 内には、メッキ層15、16が形成されている。このメッキ 層15は、内層導電層5と導通しており、メッキ層16は、 内層導電層9と導通している。

したがって、本実施例によれば、リフローパッドを盲 穴の上に形成しているため、リフローパッドのみで第3 図図示従来例の部品実装用リフローパッドと内層導通用 のパッドの両方の機能を1つで持たせることができ、第 3図図示従来例のように多層基板の外層に部品実装用リ フローパッドと内層導通用のパッドを別々に(別な場所 に)設ける必要がなく、内層導通用パッドがなくなる分 だけ実装面積を増すことができ、実装密度を向上するこ

10

とができる。

第2図には、本発明に係るプリント基板製造方法の一 実施例が示されている。

第2図(A)~第2図(I)は、プリント基板の製造 手順を示している。図において、まず、第2図(A)に 示す如く、内層パターン形成用のエッチング工程におい て、絶縁体20の両面に銅箔によって構成されている外層 導電層21、22の内、一方の外層導電層21の一部をエッチ ングによりトリミングしてウィンド23を形成する。次 に、第2図(B)に示す如く、レーザ穴明け工程におい て、ウィンド23にレーザ24を照射して絶縁体20の絶縁層 を除去し、外層導電層22に達する盲穴25を開ける。その 後、第2図(C)に示す如く、メッキ工程において、外 層導電層21及び盲穴25の外面にメッキ層26を施し、この メッキ層26によって外層導電層21と外層導電層22とが互 いに導通する。すなわち、絶縁体20の両面に設けられて いる外層導電層同志をメッキ層26で導通させている。そ して、第2図 (D) に示す如く、パターンエッチングエ 程において、一方の外層導電層21側を所定のパターンに 基づいてエッチングで除去しパターン27を形成する。

第2図 (E) においては、両面に銅箔によって構成さ れている外層導電層31、32が設けられている絶縁体30に ついて、前記第2図(A)~第2図(C)の工程を経た 後に、パターンエッチング工程において、一方の外層導 電層31側を外層導電層21のパターンとは異なるパターン に基づいてエッチングで除去しパターン37及びメッキ層 36を形成する。このようにして、第2図(D)において 製造された第1の基板と、第2図(E)において製造さ れた第2の基板との2種類の基板を製造する。

次に、第2図(F)に示す如く、積層工程において、 第2図 (D) のパターンエッチング工程で製造した第1 の基板と第2図(E)のパターンエッチング工程で製造 した第2の基板とを盲穴28の開口部と盲穴38の開口部が 積層内側に位置するように、第1の基板と第2の基板と の間に絶縁体40を介在させて重ね合わせ、加熱プレスし て多層積層板50を製作する。その後、第2図(G)に示 す如く、スルーホール穴明け工程において、基板の適宜 位置に絶縁体20、40、30、外層導電層21、22、31、32を 貫通する2つのスルーホール50、55を形成する。さら に、第2図 (H) に示す如く、メッキ工程において、外 層導電層22の上、スルーホール50、55内側、外層導電層 32の上にメッキを施し、メッキ層60を形成する。このメ ッキ層60を施すことによってスルーホール50を介してパ ターン27と外層導電層22、32とが導通し、スルーホール 55内を介してパターン37と外層導電層22、32とが導通し ている。そして、第2図(I)に示す如く、パターンエ ッチング工程において、外層導電層22とメッキ層60、外 層導電層32とメッキ層60からなる外層をエッチングし て、リフローパッド70、75及び導通スルーホール80、85 を形成する。スルーホール50内のメッキ層60とスルーホ

ール55内のメッキ層60とが切り離されてパターニングさ れる。

従来の内層から逐次積層していくプリント基板の製造 方法によったのでは、さらに内層数が増えた場合に積 層、パターン加工を繰り返すため、位置決め用穴が熱伸 縮によってダメージを受け長穴に変形し、内層材が互い にズレたり、パターンズレが発生し易やすかったもの が、本実施例によれば、一度で積層することができるた め、穴のダメージの影響をなくすことができる。

また、従来のプリント基板の製造方法によったので は、最終工程で最も信頼性の要求される盲穴加工を行う 必要が有り、基板の歩留を左右することになるが、本実 施例によれば、初期の工程で盲穴の加工をすることがで きるため、歩留の低下は最小限で済むなどのメリットが

なお、本実施例においては、銅箔によって構成されて いる外層導電層21、外層導電層31によって構成される内 層数n/2が偶数の場合を例に上げて説明したが、n/2が奇 数の場合は最外層以外の内層基板については両面にパタ ーン形成、導通メッキを施したものを積層すればよい。

【発明の効果】

本発明は、以上説明したように構成されているので、 以下に記載されるような効果を奏する。

絶縁層と該絶縁層の少なくとも一方の面に形成される 銅箔層とからなるプリント基板の一方の面から上記一方 の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該プリント基至の穴明け側 にメッキ層を形成して前記盲穴と一方の銅箔をメッキ導 通してなる2以上のプリント基板をそれぞれ盲穴が内側 になるように絶縁層を介して積層し、盲穴に接する最外 30 層銅箔層にリフローパッドを形成して構成しているの で、盲穴を有するプリント基板の実装密度を向上するこ とができる。

また、絶縁層と該絶縁層の少なくとも一方の面に形成 される銅箔層とからなるプリント基板の一方の面から上 記一方の銅箔層に至る盲穴を穿孔し該プリント基板の穴 明け側にメッキ層を形成して前記盲穴と一方の銅箔をメ ッキ導通してなる第1の基板と、絶縁層と該絶縁層の少 なくとも一方の面に形成される銅箔層とからなるプリン ト基板の一方の面から上記一方の銅箔層に至る盲穴を穿 孔し該プリント基板の穴明け側にメッキ層を形成して前 記盲穴と一方の銅箔をメッキ導通してなる第2の基板と を前記穴明け側が対向するように絶縁体を介して積層 し、さらにスルーホール穴明けをして所定銅箔層をメッ キ導通せしめ、盲穴を封止する銅箔層にリフローパッド をエッチングにより形成して製造するものであるから、 盲穴を有するプリント基板の実装密度を向上することが できる。

【図面の簡単な説明】

第1図 (A) は本発明に係るプリント基板の実施例を示 50 す平面図、第1図(B)は第1図(A)図示プリント基 9

板の断面正面図、第2図(A)~(I)は本発明に係るプリント基板製造方法の実施例を製造手順を示す断面正面図、第3図(A)は従来のプリント基板の平面図、第3図(B)は第3図(A)図示プリント基板の断面正面図、第4図(A)~(G)は従来のプリント基板製造方法の製造手順を示す断面正面図である。

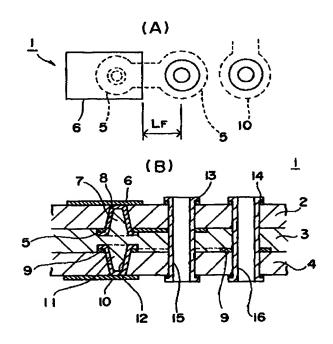
1 ……プリント基板

* 2, 3, 4, 20, 30, 40·····・ 絶縁体
5, 9·····・ 内層導電層
6, 10, 70, 75·····・リフローパッド
7, 11, 28, 38·····・ 盲穴
13, 14, 50, 55······スルーホール
21, 22, 31, 32·····・ 外層導電層

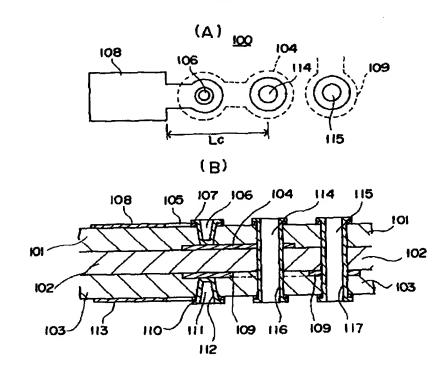
27,37……パターン

10

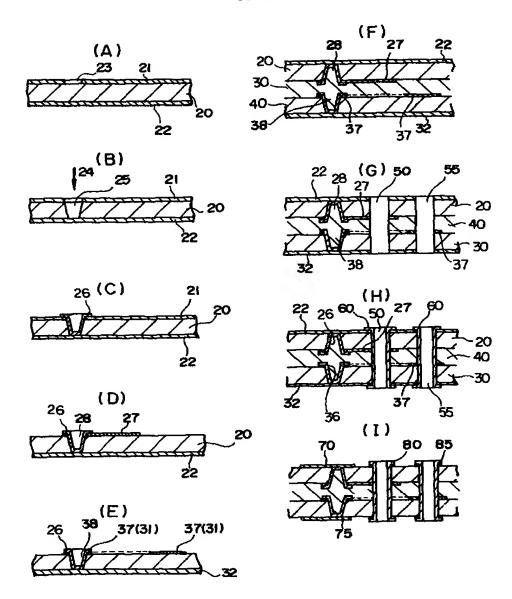
【第1図】



【第3図】



【第2図】



【第4図】

